MPCVD红外测温仪 蝶形腔测温系统

产品名称	MPCVD红外测温仪 蝶形腔测温系统
公司名称	西安固泰传感器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市明光路55号
联系电话	029-89245788 13991922361

产品详情

MPCVD红外测温仪 蝶形腔测温系统 蝶形腔CVD设备配套测温系统 MPCVD红外测温仪西安固泰传感器红外测温仪可以在以下设备中配套测温使用，比如碳化硅生长炉测温、单晶炉测温、氧化扩散炉测温、真空炉测温；MOCVD金属有机化学气相沉积（Metal-Organic Chemical Vapour Deposition）是在基板上生长半导体薄膜。

PECVD等离子增强化学气相沉积（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)是指等离子体增强化学的气相沉积。

CVD化学气相沉积（Chemical Vapor Deposition）是指高温下的气相反应。等离子体增强化学气相沉积（PECVD）\高密度等离子体化学气相淀积（HDP CVD） \微波等离子化学气相沉积（MPCVD） \微波电子回旋共振等离子体化学气相沉积（ECR-MPCVD）\真空化学气相沉积（UHV/CVD） \热化学气相沉积(TCVD) \高温化学气相沉积（HTCVD） \金属有机化合物化学气相沉积（MOCVD）\激光诱导化学气相沉积（LCVD）等。

PVD物理气相沉积（Physical Vapor Deposition)是指在真空条件下采用物理方法将材料源（固体或液体）表面气化成气态原子或分子，或部分电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的方法，物理气相沉积是主要的表面处理之一。物理气相沉积可沉积金属膜、合金膜、还可以沉积化合物、陶瓷、半导体、聚合物膜等。

ALD原子层沉积（Atomic layer deposition)是一种可以将物质以单原子膜形式一层一层的镀在基底表面的方法。原子层沉积与普通的化学沉积有相似之处。以上工况的测温具体选型欢迎联系我们。